

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年8月17日(2006.8.17)

【公表番号】特表2005-534772(P2005-534772A)

【公表日】平成17年11月17日(2005.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2005-045

【出願番号】特願2004-526019(P2004-526019)

【国際特許分類】

C 08 G 85/00 (2006.01)

B 01 J 19/00 (2006.01)

【F I】

C 08 G 85/00 Z C C

B 01 J 19/00 3 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成18年7月3日(2006.7.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

材料のコンビナトリアルライブラリーを作成するための連続法であつて：

高剪断環境および脱蔵性能を有する、プラグ流れ混合装置を提供する工程、

前記混合装置に、加熱誘起反応により変性することが可能な少なくとも1種のポリマーを含む組成物を前記反応器中に、連続的に導入する工程、

前記組成物を高剪断環境に暴露させる工程、および

変性することにより材料のコンビナトリアルライブラリーを作成することが可能な前記少なくとも1種のポリマーの性質に影響を与える、少なくとも1つの変数を導入、または経時変化させる工程、

を含む方法。

【請求項2】

前記組成物が、温度の影響を受けやすい少なくも1種のポリマーを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記加熱誘起反応が、少なくとも1種の保護基を除去して、官能基を露出させる、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記露出された官能基が、グラフト化反応を受けることが可能である、請求項3に記載の方法。